

高分子加工技術研究会 第 75 回例会の参加募集

主 催：日本レオロジー学会 高分子加工技術研究会

日 時：2011 年 6 月 17 日（金）13：30～17：00

場 所：東京工業大学 蔵前会館 手島精一記念会議室

〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1

（交通）東急目黒線・大井町線 大岡山駅下車徒歩 1 分

東京工業大学大岡山キャンパス

主題：高分子への機能性付与技術

プログラム：

1. 「磁場を用いた微結晶の精密配向制御」

首都大学東京大学院 都市環境科学研究科 准教授 山登 正文 氏

2. 「やわらかい微細構造表面 “マイクロリソグラーフ” とその応用」

産業技術総合研究所 ナノシステム研究部門 大園 拓哉 氏

3. 「ナノアロイ技術による高機能材料の創出」

東レ株式会社 化成品研究所 小林 定之 氏

参 加 費：2,000 円。高分子加工技術研究会の会員及び学生は無料。

（高分子加工技術研究会の年会費は 3,000 円です。この機会にご入会をお勧めします。）

申込方法：氏名・所属・連絡先住所を明記し、メールにて 6 月 6 日（月）までに下記宛にお申込下さい。

高分子加工技術研究会会員の方は加工研会員と書き加えて下さい。

申 込 先：〒152-8552 東京都目黒区大岡山2-12-1-S8-32

東京工業大学大学院 有機・高分子物質専攻 鞠谷研究室 竹川理恵

TEL：03-5734-2468, FAX：03-5734-2876

E-mail：takekawa.r.aa@m.titech.ac.jp